



انجمن علمی صنایع نمک ایران

# AMNC

available online @ amnc.aut.ac.ir

نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفتی و پوشش‌های نوین - ۲۵ (۱۳۹۷-۱۷۸۹)

## تأثیر اکسید گرافن احیا شده بر تخریب فتوکاتالیستی ماده رنگزای رودآمین B

حسن سامی<sup>۱,۲\*</sup>, علی اصغر صباح الوانی<sup>۳,۴</sup>, نعیمه ناصری<sup>۳</sup>, رضا سلیمی<sup>۱,۵</sup>

۱ استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۲ پژوهشگر، گروه مواد پیشرفتی، انجمن علمی رنگ ایران، تهران، ایران

۳ دانشیار، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۴ دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۵ استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران



تاریخ دریافت:  
۹۷/۰۳/۲۵

تاریخ پذیرش:  
۹۷/۰۶/۰۱

در این مطالعه تلاش شده است تا یک سامانه کامپوزیتی شامل فتوکاتالیست  $ZnV_2O_6$  و اکسید گرافن احیا شده (rGO) ساخته شود. به این منظور در گام نخست پیش‌ساز  $ZnV_2O_6$  به روش هم‌رسوبی تهیه شد و با هدف یافتن بهترین شرایط فرآیند تکلیس، در دماهای مختلف در محیط اکسیدی حرارت‌دهی شد. براساس نتایج بدست آمده از آزمون‌های پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، خلوص فازی و ریزساختار نمونه کلسینه شده در دمای ۶۰۰ درجه سلسیوس به مدت دو ساعت نسبت به سایر نمونه‌ها شرایط بهتری دارد. در گام بعدی، نانوstructurahای اکسید گرافن به روش هامرز بهبود یافته تهیه شدند و به منظور بازآرایی ساختار  $sp^2$  و درنتیجه امکان انتقال دور بُرد الکترون‌ها در آنها، ترکیبات کربنی بدست آمده به روش ترکیبی (شیمیایی و حرارتی) احیا گردیدند. در نهایت نیز، نانوکامپوزیت‌های فتوکاتالیستی  $ZnV_2O_6/rGO$  از طریق اختلاط مقداری مشخص از rGO با نانوstructurahای  $ZnV_2O_6$  تحت امواج فراصلوت بدست آمد. فعالیت فتوکاتالیستی و سینتیک واکنش تخریب ماده رنگزای رودآمین B برای کلوئیدهای مختلف فاقد ذرات فتوکاتالیست، حاوی نانوذرات  $ZnV_2O_6$  و حاوی نانوکامپوزیت‌های  $ZnV_2O_6/rGO$  اندازه‌گیری شد؛ نتایج حاکی از عملکرد فتوکاتالیستی قبل قبول برای پودرهای  $ZnV_2O_6$  به علت گاف انرژی مناسب این نیمدرسانا است. بعلاوه پس از گذشت دو ساعت، میزان تخریب ماده رنگزای برای نمونه حاوی سامانه نانوکامپوزیتی به ۷۱٪ رسیده است که در مقایسه با عملکرد همین فتوکاتالیست در غیاب GO، رشدی معادل ۲۷٪ درصد نشان می‌دهد. از این رو انتظار می‌رود تا صفحات کربنی علاوه بر افزایش سطح واژگان کلیدی

فتوکاتالیست؛ تخریب ماده رنگزای؛ اکسید گرافن؛ هم‌رسوبی.

واژگان کلیدی

جذب نور آنها گردد [۱۷]. بعنوان مثال، در تحقیقی که به تازگی توسط Hu [۱۸] و همکارانش منتشر گردیده، به منظور افزایش هدایت بین ذرهای و نیز تسهیل انتقال الکترونی در فوتوكاتالیست  $\text{BiVO}_4$ -rGO از rGO کمک گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که عملکرد فوتوكاتالیستی  $\text{BiVO}_4$  در حضور rGO تحت تابش مستقیم نور شبیه‌سازی شده خورشید به مراتب بیشتر شده است.

لذا در تحقیق حاضر تلاش شده است تا در گام نخست نیمه‌رسانای  $\text{ZnV}_2\text{O}_6$  بعنوان یک فوتوكاتالیست جدید به روش همروسوی تهییه شود. در این روش که یکی از روش‌های ساخت پایین به بالای نانومواد محسوب می‌شود، با کنترل موضعی اتم‌ها در حین فرآیند ساخت، نانوساختارهای موردنظر حاصل می‌شوند. در گام بعدی، اکسید گرافن به روش هامرز بهمودیافته تهییه شده و به منظور بازآرایی ساختار<sup>2</sup> sp<sup>2</sup> به روش ترکیبی به روش ترکیبی احیا می‌گردد. در نهایت نیز آن این صفحات کربنی به روش ترکیبی احیا می‌گردد. در نهایت نیز به منظور ارزیابی تاثیر حضور GO، عملکرد فوتوكاتالیستی پودرهای بدست آمده جهت تخریب ماده رنگزای رودآمین B اندازه‌گیری خواهد شد.

## (۲) فعالیت‌های آزمایشگاهی

### (۱۲) تهییه فوتوكاتالیست‌های $\text{ZnV}_2\text{O}_6$

پیش‌ساز فوتوكاتالیست  $\text{ZnV}_2\text{O}_6$  به روش همروسوی بعنوان یکی از روش‌های مرسوم شیمی تر تهییه شد. به این منظور مقادیر استوکیومتری مورد نیاز از مواد اولیه آمونیوم متاوانادات (۱/۱۷ گرم) و نیترات روی شش آبه (۱/۴۹ گرم) مورد استفاده قرار گرفت. از آنجائیکه جرم مولکولی ساختار  $\text{ZnV}_2\text{O}_6$  ۲۶۳/۲۵۸ g/mol می‌باشد، اساس محاسبات، سنتز ۰/۰۰۵ مول محصول معادل ۱/۳۱۶ گرم در نظر گرفته شد. جهت تهییه پیش‌ساز، ابتدا محلول‌های حاوی دو ماده اولیه بصورت جداگانه در آب عاری از یون حل شدند؛ محلول حاوی یون‌های وانادیوم با اتحال آمونیوم متاوانادات در ۵۰ mL آب برای مدت ۳۰ دقیقه تحت همزدن با دور ۴۰۰ rpm و در دمای ۸۰ درجه سلسیوس بدست آمد. محلول حاوی یون‌های روی نیز با اتحال نیترات روی شش آبه در ۲۰ mL آب در دمای اتاق پس از ۱۰ دقیقه همزدن با دور ۲۵۰ rpm حاصل شد. سپس اجازه داده شد تا دو محلول تا دمای اتاق سرد شده و بعد از آن محلول حاوی یون‌های روی به تدریج و تحت همزدن ملایم به طرف حاوی محلول یون‌های وانادیوم اضافه شد. با اضافه شدن دو محلول به یکدیگر، رنگ محلول به مرور از زرد کمرنگ به سمت زرد پررنگ تغییر کرده و با افزایش pH تا محدوده ۸ (با افزودن محلول ۱ M هیدروکسید سدیم)، رسوب پیش‌ساز بطرور کامل اتفاق افتاد. در مرحله بعد، رسوب بدست آمده با محلول حاوی نسبت حجمی مساوی از اتانول و آب طی چند مرحله به کمک سانتریفیوژ (دور ۹۰۰۰ rpm برای ۱۰ دقیقه) شستشو و سپس جداسازی شد. در نهایت نیز پودرهای بسیار نرم پیش‌ساز در دمای ۱۲۰ °C برای مدت چهار ساعت خشک و برای مرحله تکلیس

## (۱) مقدمه

تخریب نوری آلاینده‌های آلی در دهه اخیر بدليل اهمیت یافتن موضوعات مرتبط با محیط زیست از سوی محققین بسیاری مورد توجه قرار گرفته است [۱، ۲]. دی‌اکسید تیتانیوم همواره بدليل مزایایی از قبیل پایداری ترمودینامیکی، قدرت اکسیداسیون بالا و نیز غیرسمی بودن بعنوان یکی از مهم‌ترین فوتوكاتالیست‌های معدنی شناخته می‌شود. اگرچه این فوتوكاتالیست از نرخ بازترکیب سریع حامل‌های بار و نیز جذب نسبتاً کم در محدوده امواج مرئی (بدليل گاف انرژی بزرگ) رنج می‌برد [۳، ۴].

این قبیل محدودیت‌ها برای سایر نیمه‌رساناهای مرسوم نیز گزارش شده است؛ برای مثال،  $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$  اگرچه جذب مناسبی در محدوده امواج مرئی دارد (گاف انرژی ۲/۲ eV)، لیکن از بازترکیب بالای حامل‌های بار رنج می‌برد [۵]. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که جدایش بار در فوتوكاتالیست‌های  $\text{WO}_3$  و  $\text{BiVO}_4$  ضعیف بوده و سیتیک واکنش‌های فوتوكاتالیستی در آنها نسبتاً کند است [۶، ۷]. این قبیل محدودیت‌ها سبب گشته تا تحقیقات بر روی نیمه‌رساناهای جدید که قابلیت عملکرد فوتوكاتالیستی تحت امواج خورشید را داشته باشند، شدت گیرد [۸-۱۰].

به منظور بهبود خواص فوتوكاتالیستی نیمه‌رساناهای و رفع مضلات مربوطه، رویکردهای گوناگونی پیشنهاد و مورد مطالعه قرار گرفته است که از بین آنها، موضوعاتی مرتبط با مهندسی خواص فوتوفیزیکی در قالب تلچیح عناصر خارجی (جهت تنظیم مشخصه‌های نوری و الکترونی)، تهییه اتصالات ناهمسان، استفاده از کاتالیست‌های کمکی، افزایش هدایت الکترونی، افزایش سطح ویژه و درنتیجه جذب فوتون (اثر نانوذرات) و نیز تهییه کامپوزیت‌های فوتوكاتالیستی، بیش از سایر دیدگاهها مورد توجه محققین قرار گرفته است [۱۱-۱۳]. از سوی دیگر، معرفی نیمه‌رساناهای جدید، رویکرد متفاوتی در جهت رسیدن به شرایط ایده‌آل برای فوتوكاتالیست‌ها محسوب می‌شود که در این راستا گزارشات متعددی در چند سال اخیر منتشر شده است؛ از میان ترکیب‌های بر پایه اکسید وانادیوم، بطور نمونه می‌توان به ساختارهای نیزه  $\text{Cu}_3\text{V}_2\text{O}_8$  [۱۶] و  $\text{Mn}_2\text{V}_2\text{O}_7$  [۱۴] و  $\text{NiV}_2\text{O}_6$  [۱۵] اشاره نمود.

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که استفاده مناسب از اکسید گرافن احیا شده (rGO) بعنوان یک بستر کربنی دو بعدی در کنار نانوذرات فوتوكاتالیست می‌تواند با هدف تسهیل در جابجای الکترون‌ها و به تبع آن به تأخیر افتادن بازترکیب جفت‌های حامل‌های بار نقش بسزایی در ارتقای عملکرد فوتوكاتالیستی آنها داشته باشد. حضور اکسید گرافن احیا شده کمک می‌کند تا انتقال الکترون‌های تولید شده بواسطه تشکیل جفت‌های الکترون-حفره در فوتوكاتالیستی که تحت پرتودهی قرار گرفته است تسهیل شود. درنتیجه، استفاده همزمان از نیمه‌رسانا و این صفحات کربنی علاوه بر افزایش طول عمر حامل‌های بار (که با طول نفوذ آنها متناسب است)، می‌تواند سبب بهبود سایر مشخصه‌های مواد فوتوكاتالیستی نظیر مقاومت به تخریب نوری و همچنین افزایش

شدید اضافه شده و pH به کمک محلول ۱ مولار هیدروکسید سدیم تا حدود ۹ افزایش یافت؛ مخلوط بدست آمده برای مدت ۳۰ دقیقه تحت امواج فراصوت قرار گرفته و سپس اختلاط تحت همزدن شدید در دمای ۹۵°C برای ۲ ساعت ادامه پیدا کرد. اکسید گرافن احیا شده با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ با دور ۴۰۰۰ rpm برای ۱۰ دقیقه جداسازی شده و سپس با آب برای چندین مرتبه شسته شد. در نهایت نیز پودرهای تیره رنگ بدست آمده در دمای ۱۱۰°C برای یک ساعت خشک شدند. در مرحله بعد برای احیای حرارتی یک گرم اکسید گرافن در کوره‌ای که اتمسفر داخلی آن با اتصال به کپسول نیتروژن و دستگاه تولید کننده هیدروژن از طریق الکتروولیز آب، کاملاً عاری از اکسیژن بود (با نسبت ۱:۲ از هیدروژن به نیتروژن)، در دمای ۵۰۰°C به مدت ۱۵ دقیقه با نرخ گرمادهی سریع حرارت داده شد. پس از تهیه نانوساختارهای ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub> و اکسید گرافن احیا شده بصورت مجزاً از مقادیر مشخص (۳۵ mg) از اکسید گرافن احیا شده با ذرات ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub> تحت امواج فراصوت بدست آمد.

### (۳) مشخصه‌یابی فتوکاتالیست‌ها

به منظور بررسی ساختار بلوری و تبدیلات فازی از آزمون پراش اشعه ایکس استفاده شد. الگوهای XRD با استفاده از دستگاه مدل Intel (EQuinox 3000) بدست آمدند. دستگاه‌ها تحت ولتاژ و جریان ۴۰ mA و با تشعشع ۳۰ mA (Cu-Kα radiation ۱/۵۴۰۵) تنظیم شده بودند و الگوها با نرخ پویش ۲ °/min (Å) ریخت‌شناسی، ریزساختار و آنالیز عنصری نانومواد تهیه شده با استفاده از دستگاه مختلف میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (-FE-SEM) مدل Mira 3 مجهز به طیف‌نگار پاشندگی انرژی اشعه ایکس (EDS) مدل Thermo Noran Stereoscan S 360 تعیین شد. ولتاژ شتاب در حین انجام آزمون مدل Varian Cary 50 spectrometer ثابت شد. فعالیت فتوکاتالیستی نانومواد تهیه شده نیز از طریق اندازه‌گیری مشخصه‌های جذبی و محاسبه ۵ کیلوولت بود. برای اندازه‌گیری مشخصه‌های جذبی و محاسبه ۲۰ گاف انرژی فتوکاتالیست‌ها، طیف‌های عبوری توسط دستگاه Varian Cary 50 spectrometer ثابت شد. فعالیت فتوکاتالیستی نانومواد در یک فوتوراکتور که با تابش‌دهی لامپ زنون با توان ۳۰۰ وات B در یک فوتوراکتور که با تابش‌دهی آب تعادل جذب-واجدب بین آنها ایجاد شود و سپس تحت تابش‌دهی مستقیم قرار گرفتند. دمای کلوئید در حین پرتودهی به کمک جریان خنک کننده آب، ثابت نگه داشته شد. فاصله منبع نوری تا کلوئید ۱۵ cm در نظر گرفته شد. در این شرایط، چگالی تابشی در سطح کلوئید به کمک یک تابش سنج متحرک معادل ۶۸۴×۱۰³ cd در داخل محفظه تاریک افزایش گرفت. در فواصل زمانی معین (هر ۲۰

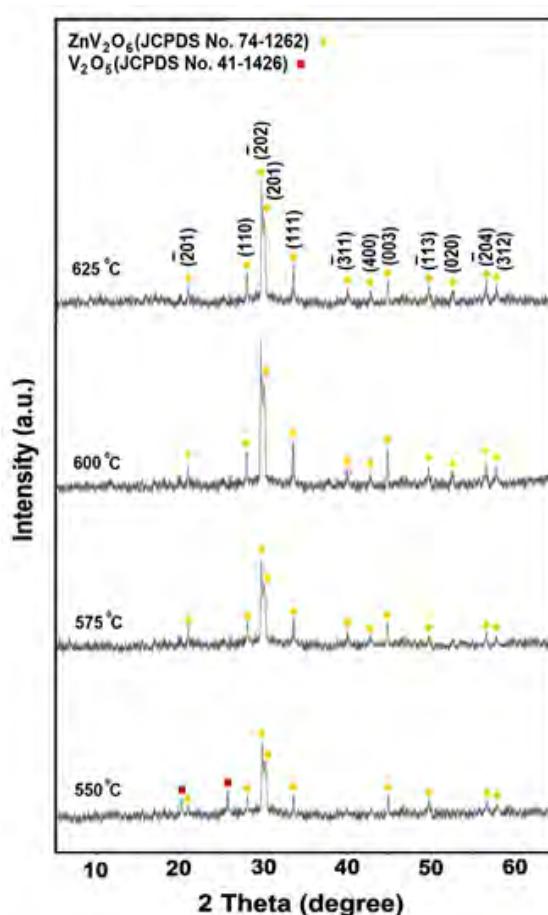
آمده شدند. پس از آمده شدن مواد پیش‌ساز، پودرهای بدست آمده در کوره اکسیدی تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند تا فاز بلوری موردنظر تشکیل شوند. فرآیند تکلیس برای ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub> به مدت دو ساعت به ترتیب در ۵۷۵، ۵۵۰، ۶۰۰ و ۶۲۵ درجه سلسیوس انجام شد. نرخ حرارت‌دهی در این مرحله معادل ۱۰ °C/min تنظیم شد.

### (۲) تهیه نانوکامپوزیت‌های ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub>/rGO

ابتدا تلاش شد تا اکسید گرافن احیا شده بعنوان بستر کربنی مورد نظر جهت اختلاط با نانوذرات فتوکاتالیست تهیه شود. به این منظور پراکنه آبی نانوصفحات اکسید گرافن به روش هامرز اصلاح شده آمده شد [۱۹]. مرحله نخست در این روش، تهیه گرافیت منبسط شده است؛ برای این کار به ازای هر گرم گرافیت اولیه، به ۱۵ mL اسید سولفوریک و ۵ mL اسید نیتریک (نسبت حجمی ۳ به ۱) نیاز است. اختلاط گرافیت و مخلوط اسیدها برای مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق تحت همزدن ملایم انجام شده و سپس ۴۰ mL آب عاری از یون به تدریج به آن اضافه می‌شود. لازم به ذکر است چون این مرحله با افزایاد دما همراه است، ظرف حاوی محتويات فوق، پیش از اضافه شدن آب در داخل حمام بخ قرار می‌گیرد. جداسازی گرافیت از محلول به کمک دستگاه سانتریفیوژ (دور ۳۰۰۰ rpm برای ۵ دقیقه) انجام شد و پودرهای بدست آمده در دمای ۶۰°C برای مدت یک ساعت خشک و در نهایت برای چند دقیقه درون کوره اکسیدی با هدف ایجاد شوک حرارتی، در دمای ۵۰۰°C حرارت دیدند. در ادامه برای تهیه اکسید گرافن، به ازای هر گرم گرافیت منبسط شده، به ۶ گرم پتانسیم پرمنگنات و ۱۰۰ میلی‌لیتر اسید سولفوریک نیاز است. فرآیند افزودن اسید و عامل اکسیدکننده به تدریج انجام گرفت و به کمک حمام بخ از افزایش ناگهانی دما جلوگیری شد. سپس مخلوط برای ۲۴ ساعت در دمای ۳۰°C تحت همزدن قرار گرفت و بعد از تکمیل فرآیند اکسایش، مخلوط حاوی ۲۵ mL آب عاری از یون و ۲۵ mg اکسیدکننده به تدریج به آن اضافه شد. با اتمام واکنش، رنگ کلوئید بدست آمده زرد متمایل به قهوه‌ای می‌شود که آن را می‌توان بعنوان یک نشانه بصری برای انجام موقفيت‌آمیز فرآیند اکسایش تلقی نمود. سپس مخلوط بدست آمده با استفاده از سانتریفیوژ جداسازی شده و با آب شستشو داده می‌شود. جهت تخلیص، فرآیند سانتریفیوژ با افزودن اسید هیدروکلریک ۱۰% برای حداقل سه بار تکرار می‌شود. در نهایت نیز به منظور تورق بهتر صفحات، مخلوط بدست آمده از مرحله سانتریفیوژ برای مدت ۳۰ دقیقه در حمام امواج فراصوت قرار گرفت. در نهایت هم به منظور بازآرایی ساختار مزدوج در اکسید گرافن تهیه شده از مرحله قبل، فرآیند احیای اکسید گرافن به روش ترکیبی انجام شد. در روش احیای ترکیبی ابتدا اکسید گرافن به روش شیمیایی با اسید آسکوربیک و سپس به روش حرارتی احیا گردید. در روش احیای شیمیایی، ۵۰ mg اسید آسکوربیک بعنوان عامل کاهنده به ۵۰ mL از پراکنه آبی اکسید گرافن (۱ g L⁻¹) در دمای اتاق، تحت همزدن

برای دو نمونه تکلیس شده در دماهای ۶۰۰ و ۶۲۵ درجه سلسیوس در شکل ۲ قابل مشاهده است؛ ریزساختار ذرات در نمونه حرارت دیده در ۶۰۰°C بسیار منظم و کروی شکل می‌باشد. در این نمونه ذرات کاملاً از یکدیگر جدا بوده و میانگین اندازه آنها در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر تخمین زده می‌شود. اما برای نمونه حرارت دیده در دمای بالاتر، به نظر می‌رسد که بدلیل تفجوشی موضعی، ذرات شروع به ادغام شدن در یکدیگر کرده که این موضوع ضمن حذف تدریجی مرزدانه‌ها، سبب رشد قابل توجه اندازه ذرات از طریق سازوکار موسوم به پدیده اسوال راپینینگ نیز شده است. حذف مرزدانه‌ها عموماً با نابجایی‌های نواحی بلوری و ایجاد تنفس همراه بوده که منجر به پیدایش عیوب سطحی و فضاهای خالی اکسیژن شده و در نهایت می‌تواند بر روی خواص نوری فوتوکاتالیست‌ها تاثیر منفی داشته باشد [۲۱]. لذا به نظر می‌رسد که در تایید نتایج XRD، برگزیدن دمای ۶۰۰°C برای فرآیند تکلیس انتخاب مناسبی باشد.

به منظور تخمین گاف انرژی نانوساختارهای  $ZnV_2O_6$  از داده‌های جذب UV-Vis و معادله تاک استفاده شد. به نظر می‌رسد که لبه جذب برای این فوتوکاتالیست در حدود ۵۰۰ نانومتر می‌باشد که



شکل ۱: الگوهای XRD پیش‌ساز تهیه شده به روش هم‌رسوبی پس از تکلیس در دماهای مختلف برای ۲ ساعت

دقیقه)، با برداشت حدود ۵ mL از کلوئید، غلظت ماده رنگزا از روی قله ۵۵۴ nm متعلق به رودآمین B به کمک طیف‌سنجی UV-Vis و قانون بیر-لامبرت تخمین زده شد. غلظت اولیه مورد استفاده از ماده رنگزا و فوتوکاتالیست در این آزمون به ترتیب  $20 \text{ mg/L}$  و  $1 \text{ g/L}$  بود. پس از هر بار اندازه‌گیری، با جداسازی ذرات فوتوکاتالیست به کمک سانتریفیوژ و بازگرداندن پودرها به ظرف واکنش، تلاش شد غلظت فوتوکاتالیست در کلوئید تا حد امکان ثابت بماند.

### (۳) نتایج و بحث

#### (۱) فوتوکاتالیست $ZnV_2O_6$

در ابتدا تلاش شد تا شرایط تکلیس فوتوکاتالیست‌های بر پایه  $ZnV_2O_6$  در روش هم‌رسوبی بهینه گردد؛ از آنجاییکه سرعت واکنش‌ها در واکنش‌های حالت جامد، به نرخ نفوذ یون‌ها، سطح تماس مواد اولیه و همچنین نرخ هسته‌زایی وابسته است، دما و مساحت سطح واکنش‌دهنده‌ها نقش به سزایی در بلورینگی مواد نهایی دارد. از این رو پس از تهیه پیش‌ساز به روش هم‌رسوبی، نمونه‌ها در چهار دمای ۵۵۰، ۵۷۵، ۶۰۰ و ۶۲۵ درجه سلسیوس برای مدت دو ساعت با هدف دستیابی به بالاترین خلوص فازی تحت محیط اکسیدی حرارت دیدند. الگوهای پراش اشعه ایکس برای هر چهار نمونه در شکل ۱ نمایش داده شده است؛ به نظر می‌رسد که با افزایش دما از ۵۵۰ به ۵۷۵ درجه، بر شدت قله‌های مربوط به فاز ناخالصی  $V_2O_5$  محو شده است. حضور شده و قله‌های مربوط به فاز ناخالصی  $V_2O_5$  محو شده است. حضور پیک‌های فرعی در الگوی نخست، نشان‌دهنده ناخالص بودن فاز بدست آمده و نیز شدت ضعیف پیک‌های اصلی، بیانگر درجه بلورینگی پایین محصول بدست آمده در این دما می‌باشد. با ادامه روند افزایش دما، در دمای ۶۰۰°C بالاترین میزان خلوص فازی مشاهده می‌گردد، به نحوی که این الگو مطابقت خوبی با الگوی شماره ۱۲۶۲ از مجموعه الگوهای استاندارد JCPDS دارد [۲۰]. در دمای ۶۲۵°C مجدداً از شدت پیک‌های مشخصه فاز  $ZnV_2O_6$  کاسته شده است. از آنجاییکه مشخصه‌های نوری فوتوکاتالیست‌ها نظیر طول عمر اکسایتون‌ها، به خلوص فازی در آنها کاملاً وابسته است، لذا دمای ۶۰۰°C عنوان دمای بهینه جهت ساخت فوتوکاتالیست‌های بر پایه  $ZnV_2O_6$  به روش هم‌رسوبی انتخاب شد.

ثبت شبکه برای این نمونه با در نظر گرفتن ساختار مونوکلینیک و با استفاده از اندیس‌های میلر به ترتیب معادل  $a=9.247$ ,  $b=5.31$ ,  $c=6.569$  و  $\beta=111/22$ ,  $c=6/588$  و  $\beta=111/37$ ,  $a=9/527$ ,  $b=3/527$ ,  $a=9/265$ ,  $b=3/527$ ,  $a=9/265$  تایید می‌کند که ماده بدست آمده از خلوص فازی قابل قبولی برخوردار است. در ضمن به کمک رابطه دبای-شرر و متوسطگیری از نتایج مربوط به سه پیک شاخص  $(022)$ ,  $(201)$  و  $(111)$ ، میانگین اندازه بلورک‌ها در این نمونه در حدود ۲۶ nm تخمین زده شد.

ریخت‌شناسی بدست آمده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

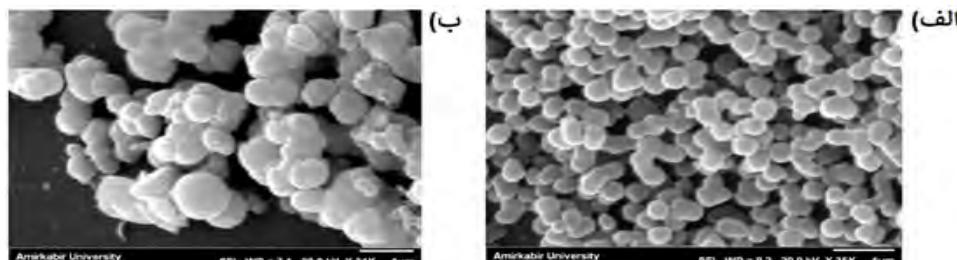
نشان می‌دهد. در حالیکه پس از دو ساعت، میزان تخریب ماده رنگزا تنها ۶٪ بوده است، این میزان برای حالت حاوی فوتوكاتالیست‌های بدست آمده از روش هم‌رسوبی به ۴۴٪ رسیده است؛ این مقدار در مقایسه با عملکرد بسیاری از فوتوكاتالیست‌های گزارش شده در مراجع، فعالیت فوتوكاتالیستی قابل قبولی را برای پودرهای تهیه شده تحت پرتودهی نشان می‌دهد [۲۳، ۲۴]. همچنین ثوابت سرعت واکنش‌های فوتوكاتالیستی با استفاده از مدل سینتیکی شبکه درجه اول (رابطه ۱) و خطی‌سازی وابستگی  $\ln(C_0/C)$  بر حسب زمان در جدول ۱ آورده شده است. در این معادله،  $C_0$  و  $C$  به ترتیب غلظت ماده رنگزا در لحظه ابتدایی و در زمان  $t$  است. همچنین  $k$  ثابت واکنش با واحد  $\text{min}^{-1}$  می‌باشد.

$$-\ln(C/C_0) = kt \quad (1)$$

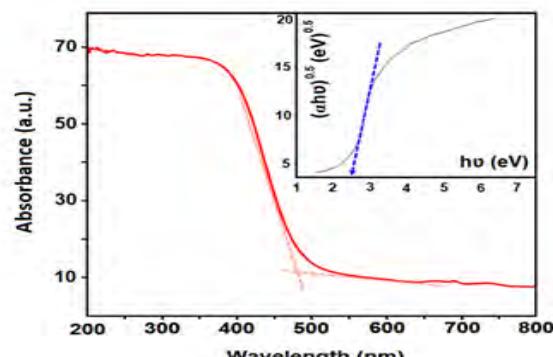
$$-\ln(C/C_0) = kt \quad (1)$$

این نتیجه از رنگ زرد نمونه‌ها نیز قابل پیش‌بینی بود. براساس رابطه تاک، عبارت  $\alpha h\nu - E_g^{1/4}$  متناسب است که در آن ضریب جذب،  $h$  ثابت پلانک،  $\nu$  بسامد و  $E_g$  گاف انرژی است. مقدار  $k$  نیز بسته به نوع انتقال الکترونی می‌تواند  $0, 1/5, 2, 3$  و  $4$  باشد. ترتیب برای انتقالات مستقیم مجاز، مستقیم غیرمجاز، غیرمستقیم مجاز و غیرمستقیم غیرمجاز باشد [۲۲]. همانطور که در شکل داخلی ۳ نمایش داده شده، با فرض گاف غیرمستقیم برای نیمه‌رسانای  $ZnV_2O_6$  برآش در ناحیه خطی برای حالتی که  $k=2$  در نظر گرفته شده ترسیم گشت؛ در این شرایط گاف انرژی برای این نیمه‌رسانا در حدود  $2/5 eV$  تخمین زده شد.

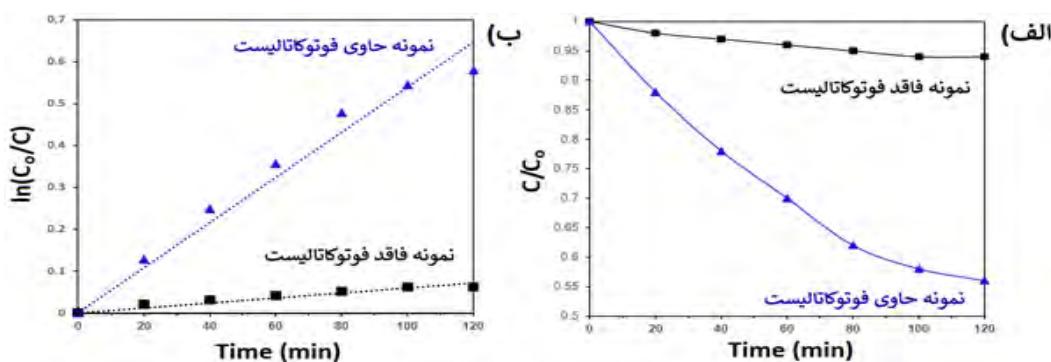
شکل ۴ (الف) رفتار تخریب ماده رنگزای رودامین B را در دو محلول مختلف فاقد فوتونکاتالیست و حاوی بودرهای  $ZnV_2O_6$



شکل ۲: تصاویر SEM مریبوط به  $ZnV_6O_6$  پس از تکلیس در دمای ۶۰۰ (الف) و ۶۲۵ (ب) درجه سلسیوس به مدت دو ساعت



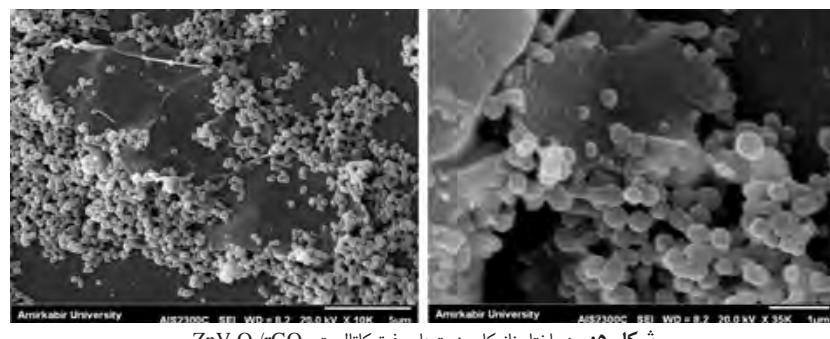
**شکل ۳:** طیف جذبی UV-Vis برای فتوکاتالیست  $ZnV_2O_6$  و نمودار تاک بدست آمده  
حتمت تخمین. گاف انزه، (تصویر داخا)



**شکل ۴:** فعالیت فوتوکاتالیستی ZnV<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (الف) و سنتیک واکنش تخریب ماده (نگاره ب) برای نمونه‌های مختلف

جدول ۱: ثوابت سرعت حاصل از تطبیق مدل سینتیکی شبه درجه اول برای عملکرد فتوکاتالیستی نمونه‌ها

دقت خطی‌سازی ( $R^2$ )	ثابت سرعت $10^4 \times \text{min}^{-1}$	نمونه
۰/۹۳	۶	کلرئید فاقد فتوکاتالیست
۰/۹۷	۵۴	ZnV <sub>2</sub> O <sub>6</sub> /rGO

شکل ۵: ریزاساختار نانوکامپوزیت‌های فتوکاتالیستی ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub>/rGO

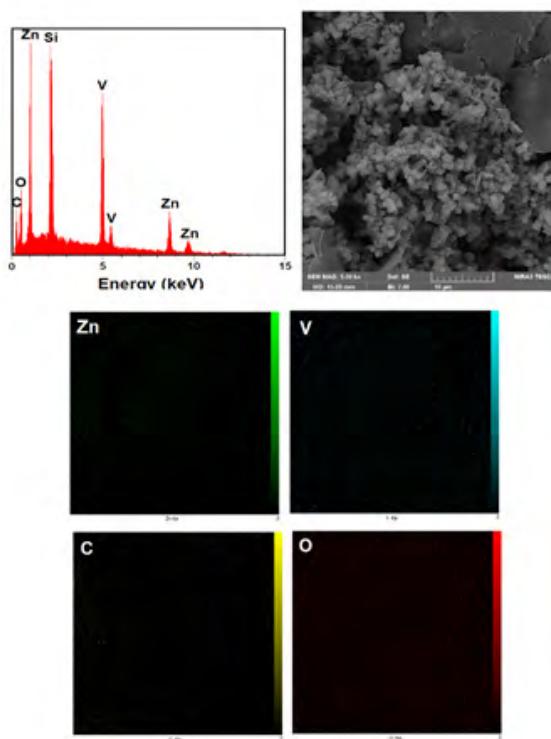
جدول ۲: ثوابت سرعت حاصل از تطبیق مدل سینتیکی شبه درجه اول برای عملکرد فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت‌ها

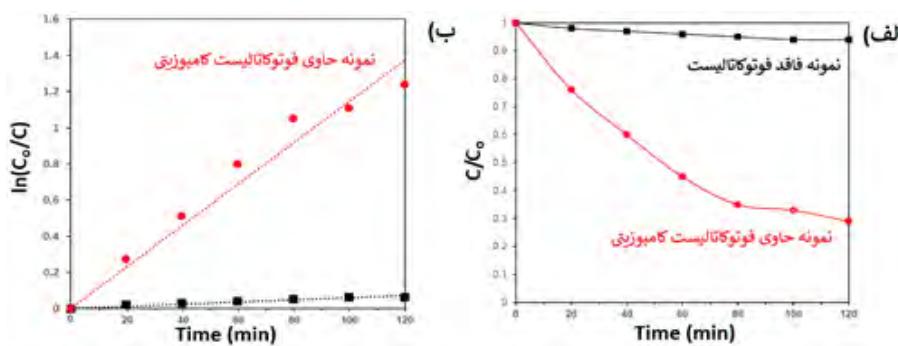
دقت خطی‌سازی ( $R^2$ )	ثابت سرعت $10^4 \times \text{min}^{-1}$	نمونه
۰/۹۳	۶	کلرئید فاقد فتوکاتالیست
۰/۹۵	۱۱۵	ZnV <sub>2</sub> O <sub>6</sub> /rGO

### (۲۳) فتوکاتالیست rGO/ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub>

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نانوکامپوزیت تهییه شده، شامل ذرات کروی ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub> در تماس با صفحات گرافی در شکل ۵ آورده شده است. همانطور که مشخص است در این نمونه، صفحات کربنی با ابعاد بسیار بزرگ‌تر در مقایسه با نانوساختارهای فتوکاتالیستی، توانسته‌اند بعنوان بستری مناسب این ذرات را در بر گیرند. پیش‌بینی می‌شود که بواسطه حضور این صفحات دو بعدی، فرآیند انتقال بار در سازوکارهای فتوکاتالیستی راحت‌تر صورت پذیرد.

همچنین جهت آنالیز عنصری نانوکامپوزیت‌ها، از طیف‌نگار پاشندگی انرژی اشعه ایکس بهره گرفته شد. در شکل ۶ طیف EDS در کنار توزیع عناصر مختلف موجود در کامپوزیت ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub>/rGO نمایش داده شده است. براساس نتایج بدست آمده، حضور هر چهار عنصر روی، وانادیوم، اکسیژن و کربن با میانگین درصد اتمی به ترتیب  $۰/۰۳$ ،  $۱۸/۵۷$ ،  $۵۲/۱۶$  و  $۲۱/۲۴$  می‌شود. تایید می‌شود که این نسبت‌ها به مقادیر استوکیومتری در این فتوکاتالیست نزدیک است. همچنین توزیع همگن عناصر مختلف در این نمونه مشهود به نظر می‌رسد.

شکل ۶: نتایج مربوط به آزمون EDS برای نانوکامپوزیت‌های ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub>/rGO

شکل ۷: فعالیت فتوکاتالیستی  $ZnV_2O_6/rGO$  (الف) و سینتیک واکنش تخریب ماده رنگرا (ب) برای نمونه‌های مختلف

پس از گذشت دو ساعت، میزان تخریب ماده رنگرا برای نمونه حاوی سامانه نانو کامپوزیتی به ۷۱٪ رسیده است که در مقایسه با  $ZnV_2O_6$  rGO، رشدی معادل ۲۷٪ درصد همین فتوکاتالیست در غیاب  $ZnV_2O_6$  rGO درصد نشان می‌دهد. از این رو انتظار می‌رود تا صفحات کربنی با فراهم نمودن شرایطی که در آن فرآیندهای به دام انداختن الکترون و انتقال آنها تسهیل می‌شود، نرخ بازتر کیب اکسایتون‌های به وجود آمده تحت پرتودهی را کاهش داده که این موضوع ارتقای عملکرد فتوکاتالیستی سامانه کامپوزیتی را به همراه داشته است.

در نهایت به منظور ارزیابی عملکرد فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت‌های تهیه شده، مجدداً از آزمون تخریب ماده رنگزای رودامین B تحت پرتودهی استفاده شد. شکل ۷ فعالیت فتوکاتالیستی و سینتیک واکنش تخریب ماده رنگرا را در دو محلول فاقد فتوکاتالیست و حاوی نانو کامپوزیت‌های فتوکاتالیستی  $ZnV_2O_6/rGO$  نشان می‌دهد؛ پس از گذشت دو ساعت، میزان تخریب ماده رنگرا به ۷۱٪ رسیده است که در مقایسه با عملکرد همین فتوکاتالیست در غیاب  $ZnV_2O_6$  rGO، رشدی معادل ۲۷٪ درصد نشان می‌دهد. از این رو انتظار می‌رود تا صفحات کربنی علاوه بر افزایش سطح ویژه لایه فتوکاتالیستی و جذب بیشتر نور برخوردی، با قابلیت به دام انداختن الکترون‌ها و انتقال دادن سریع آنها، از نرخ بازتر کیب اکسایتون‌های به وجود آمده در فتوکاتالیست بکاهند که این امر در نهایت به افزایش عملکرد فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت‌های  $ZnV_2O_6/rGO$  در تخریب ماده رنگزای رودامین B منجر گردیده است.

#### (۴) نتیجه‌گیری

بطور خلاصه، در این تحقیق یک سامانه کامپوزیتی از اختلاط فیزیکی فتوکاتالیست‌های  $ZnV_2O_6$  و اکسید گرافن احیا شده ساخته شد. پس از تهیه پیش‌ساز  $ZnV_2O_6$  به روش همروسوبی (بعنوان یکی از روش‌های مرسوم شیمی‌تر)، شرایط فرآیند تکلیس برای این نیمه‌رسانا بهینه شد. از سوی دیگر، نانو‌صفحات اکسید گرافن به روش هامز بهبود یافته آمده شدند و به منظور بازاری ساختار  $sp^2$  در آنها در یک فرآیند دومرحله‌ای احیا شدند. در روش احیای ترکیبی، ابتدا اکسید گرافن به روش شیمیابی با اسید آسکوربیک و سپس به روش حرارتی احیا گردید. نانو کامپوزیت‌های فتوکاتالیستی  $ZnV_2O_6/rGO$  نیز از طریق اختلاط  $rGO$  با نانو‌ساختارهای  $ZnV_2O_6$  تحت امواج فراصوت بدست آمدند. نتایج ارزیابی عملکرد فتوکاتالیستی نمونه‌های بدست آمده حاکی از قدرت قابل قبول نانوذرات  $ZnV_2O_6$  به دلیل گاف انرژی مناسب این نیمه‌رسانا در تخریب ماده رنگزای رودامین B است. علاوه

## (۵) مراجع

- goire, Mn<sub>2</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub>: an earth abundant light absorber for solar water splitting, *Adv Energy Mater.* 5 (2015) 1401840-1401846.
- [16] J.A. Seibold, N.R. Neale, All first row transition metal oxide photoanode for water splitting, *Chem. Mater.* 27 (2015) 1005-1013.
- [17] L. Sun, Y. Wang, F. Raziq, Y. Qu, L. Bai, L. Jing, Enhanced photoelectrochemical activities for water oxidation and phenol degradation on WO<sub>3</sub> nanoplates by transferring electrons and trapping holes, *Sci. Rep.* 7 (2017) 1303-1310.
- [18] Yingfei Hu, Yao Su, Huiting Huang, Qinfeng Qian, Zhongjie Guan, "Enhancement of Photoelectrochemical Performance in Water Oxidation over Bismuth Vanadate Photoanodes by Incorporation with Reduced Graphene Oxide," *Chemcatchem*, vol. 7, pp. 2979-2985, 2015.
- [19] J.K. Meng, Y. Cao, Y. Suo, Y.S. Liu, J.M. Zhang, X.C. Zheng, Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Performance of Amorphous SiO<sub>2</sub> Nanospheres/Graphene Composites, *Electrochim. Acta*, 176 (2015) 1001-1009.
- [20] Y. Sun, C. Li, L. Wang, Y. Wang, X. Ma, P. Ma, M. Song, Ultralong monoclinic ZnV<sub>2</sub>O<sub>6</sub> nanowires: their shape-controlled synthesis, new growth mechanism, and highly reversible lithium storage in lithium-ion batteries, *RSC Adv.* 2 (2012) 8110-8115.
- [21] A. Senthamizhan, B. Balusamy, Z. Aytac, T. Uyar, Grain boundary engineering in electrospun ZnO nanostructures as promising photocatalysts, *CrystEngComm* 18 (2016) 6341-6351.
- [22] Z. Chen, H. Dinh, E. Miller, Photoelectrochemical water splitting, Springer-Verlag New York 2013.
- [23] S. Liu, J. Tian, L. Wang, Y. Luo and X. Sun, One-pot synthesis of CuO nanoflower-decorated reduced graphene oxide and its application to photocatalytic degradation of dyes, *Catal. Sci. Technol.* 2 (2012) 339-344.
- [24] P. Hu, J. Niu, M. Yu, S.Y. Lin, Facile Solvothermal Synthesis of Reduced Graphene Oxide-BiPO<sub>4</sub> Nanocomposite with Enhanced Photocatalytic Activity, *Chinese J Anal. Chem.* 45 (2017) 357-362.
- [1] A. Salama, A. Mohamed, N.M. Aboamer, T.A. Osman, A. Khattab, Photocatalytic degradation of organic dyes using composite nanofibers under UV irradiation, *Appl. Nanosci.* 8 (2018) 155-161.
- [2] S. Thirumalairajan, K. Girija, V.R. Mastelaro, N. Ponpandian, Photocatalytic degradation of organic dyes under visible light irradiation by floral-like LaFeO<sub>3</sub> nanostructures comprised of nanosheet petals, *New J. Chem.* 38 (2014) 5480-5490.
- [3] L. Zhao, X.F. Chen, X. C. Wang, Y. J. Zhang, W. Wei, Y. H. Sun, M. Antonietti, M.M. Titirici, One-Step solvothermal synthesis of a Carbon-TiO<sub>2</sub> dyade structure effectively promoting visible-light photocatalysis, *Adv. Mater.* 22 (2010) 3317-3321.
- [4] Y. Liu, Hydrothermal synthesis of TiO<sub>2</sub>-RGO composites and their improved photocatalytic activity in visible light, *RSC Adv.* 4 (2014) 36040-36045.
- [5] K. Sivula, F. Le Formal, M. Gratzel, Solar water splitting: progress using hematite ( $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) photoelectrodes, *ChemSusChem* 4 (2011) 432-449.
- [6] F.F. Abdi, T.J. Savenije, M.M. May, B. Dam, R. van de Krol, The Origin of Slow Carrier Transport in BiVO<sub>4</sub> Thin Film Photoanodes: A Time-Resolved Microwave Conductivity Study, *J. Phys. Chem. Lett.* 4 (2013) 2752-2757.
- [7] F.M. Pesci, A.J. Cowan, B.D. Alexander, J.R. Durrant, D.R. Klug, Charge Carrier Dynamics on Mesoporous WO<sub>3</sub> during Water Splitting, *J. Phys. Chem. Lett.* 2, (2011) 1900-1903.
- [8] J. Gan, X. Lu, B.B. Rajeeva, R. Menz, Y. Tong, Y. Zheng, Efficient Photoelectrochemical Water Oxidation over Hydrogen-Reduced Nanoporous BiVO<sub>4</sub> with Ni-Bi Electrocatalyst, *ChemElectroChem.* 2 (2015) 1385-1395.
- [9] T. Kako, X. Meng, J. Ye, Solid-base loaded WO<sub>3</sub> photocatalyst for decomposition of harmful organics under visible light irradiation, *APL Mater.* 3 (2015) 104411.
- [10] J. Zhang, Y. Huang, L. Jin, F. Rosei, F. Vetrone, J.P. Claverie, Efficient Upconverting Multiferroic Core@Shell Photocatalysts: Visible-to-Near-Infrared Photon Harvesting, *ACS Appl. Mater. Inter.*, 9 (2017) 8142-8150.
- [11] T. Savio J. A. Moniz, Visible-light driven heterojunction photocatalysts for water splitting: a critical review, *Energy Environ. Sci.* 8 (2015) 731-759.
- [12] T. Chaoran Jiang, Photoelectrochemical devices for solar water splitting: materials and challenges, *Chem. Soc. Rev.* 46 (2017) 4645-4660.
- [13] M. Xiaobo Chen, Semiconductor-based photocatalytic hydrogen generation, *Chem. Rev.* 110 (2010) 6503-6570.
- [14] H.X. Dang, A.J.E. Rettie, C.B. Mullins, Visible-Light-Active NiV<sub>2</sub>O<sub>6</sub> Films for Photoelectrochemical Water Oxidation, *J. Phys. Chem. C* 119 (2015) 14524-14531.
- [15] Q. Yan, G. Li, P.F. Newhouse, J. Yu, K.A. Persson, J.M. Gre-